# IN Q UNITED STATES PATENT AND TRAD ARK OFFICE

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231		Atty. Dkt.: 461-40						PTO	
Sir:		Date:	Dece	ember 20, 20	JU1			S	)224 
Invention Entitle and in 19 19 6	ncluding attachments as noted below:  Newly executed Declaration, Copy of Depages of specification and claims (including sheets of accompanying drawing/s.  Record the attached assignment and return Attached is a Power of Attorney.  Priority is hereby claimed under 35 U.S.C.  Application Number	eclara g 10 n	umbe e und	red claims), ersigned. d on the follo <b>Country</b>	and		ations: <b>Day/Month</b> /		
	2000-393021 2001-326481			Japan Japan			25 Decem 24 Octob		
	, respectively, the entire content of which is Certified copy(ies) of foreign application(s) Certified copy(ies) filed on	g the f g the f part of in this life f onside listing "Sm	e attaclin priorion following filed following Application in sure the agreement of the file of the fil	ned. r appln. no. ng paragrap , the e ng paragrap ication No. cation ure co-pende art cited in th at art is atta	h be ntire ency.	ofore the first line content of whice fore the first line filled	filed e:This appli th is hereby in e:This appli , the en h by applicant	corpor cation tire cor	rated by is a  ntent of
Also attached: Information Disclosure Statement; Information Request; Information Disclosure Statement; Information Request; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Collection; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement deleting Inventor(s) named in prior application; Information Disclosure Statement									
Total e Indepe If any p	FILING FEE IS BASED ON C Filing Fee effective claims 10 - 20 (at least 20) = endent claims 2 - 3 (at least 3) = endent claims now added fo all entity," then enter half (1/2) of subtotal and su	r first ti	0 x 0 x	\$ 18.00 \$ 84.00		improper)	SUBTOTAL	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	740.00 0.00 0.00 0.00 740.00 0.00)
Assignment Recording Fee (\$40.00)							D SUBTOTAL	\$ \$	740.00 40.00
The Co	ture submission requiring an extension of time in promissioner is hereby authorized to charge any charboard have been filed herewith (or with any icate copy of this sheet is attached.	deficie	ency, o	r credit any o	verpa	ition for such time ayment, in the fee	e(s) filed, or ass		
Arlingte Teleph	North Glebe Road, 8 <sup>th</sup> Floor on, Virginia 22201-4714 none: (703) 816-4000 nile: (703) 816-4100 dc				: La	ANDERHYE P.C rry S. Nixon, Reg		Lyp	

## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年12月25日

出願番号

Application Number:

特願2000-393021

出 願 人 Applicant(s):

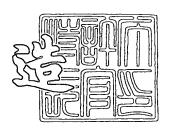
株式会社デンソー

2001年11月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

Dal





【書類名】

特許願

【整理番号】

N-72430

【提出日】

平成12年12月25日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B01J 27/224

【発明の名称】

排ガス浄化フィルタ

【請求項の数】

5

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】

石原 幹男

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】

西村 養

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】

山下 博史

【特許出願人】

【識別番号】

000004260

【氏名又は名称】

株式会社デンソー

【代理人】

【識別番号】

100079142

【弁理士】

【氏名又は名称】

髙橋 祥泰

【選任した代理人】

【識別番号】

100110700

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩倉 民芳

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009276

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9004767

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】 排ガス浄化フィルタ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 隔壁に囲まれた多数のセルを有するハニカム状の排ガス浄化フィルタにおいて,

上記セルの両端のいずれか一方の端部に栓を有し、上記排ガス浄化フィルタの 両端面上において上記栓のある端部と無い端部とがそれぞれ交互に位置し、

流体経路の下流側に配設されるべき上記栓の少なくとも一部は,流体が貫通可能な開口部を有する部分栓であり,

かつ,上記セルに進入した流体が上記隔壁を通過する際の圧力損失が,上記部 分栓を通過する圧力損失よりも小さくなるよう構成されていることを特徴とする 排ガス浄化フィルタ。

【請求項2】 請求項1において、上記上流側に位置する栓のすべては、流体の通過を完全に遮断する完全な栓であることを特徴とする排ガス浄化フィルタ

【請求項3】 請求項1又は2において、上記部分栓の上記開口部の面積をB,上記セルの開口面積をAとした場合、栓詰め率((A-B)/A)×100が5~80%の範囲にあることを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか1項において,上記排ガス浄化フィルタの下流側端面に位置する上記栓のうち,上記下流側端面の中央部分に位置する上記栓が上記部分栓であり,その周囲に位置する上記栓は流体の通過を完全に 遮断する完全な栓であることを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

【請求項5】 請求項1~3のいずれか1項において、上記排ガス浄化フィルタの下流側端面に位置する上記栓のすべてが上記部分栓であることを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】

本発明は、セラミック製ハニカムフィルタ用の排ガス浄化フィルタに関する。

[0002]

#### 【従来技術】

自動車のエンジンのような内燃機関から排出されるカーボン微粒子等のパティキュレートを浄化する手段として、フィルタにより一旦パティキュレートを捕集し、これをその後ヒータ等による加熱もしくは触媒により燃焼除去する方法がとられている。

[0003]

触媒をコーティングしたフィルタは、多数のセルを有するハニカム構造体を排 ガス浄化フィルタとし、その隔壁に触媒をコーティングしたものである。従来の 排ガス浄化フィルタ9は、図8、図9に示すごとく、セル90の両端の一方を栓 95によって交互に栓詰めした構造のハニカム構造体を用いる。すなわち、図9 に示すごとく、上流側の端面91においては、セル端部を栓95を用いて、例え ば市松模様状に交互に栓詰めする。そして、下流側の端面92においては、上流 側に栓がないセル90の端部を栓95により栓詰めし、一方、上流側で栓95が あるセル90の端部を開放したままとする。そして、隔壁98には触媒を担持さ せる。

[0004]

このような排ガス浄化フィルタ9を用いれば、内燃機関の排気ガスが通過する際に隔壁にパティキュレートが捕集され、これが高温の排気ガスの熱により触媒作用によって燃焼除去される。

[0005]

【解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の排ガス浄化フィルタ9においては、次の問題がある

即ち,図10に示すごとく、上記排ガス浄化フィルタ9に流入する排気ガス8から捕集されるパティキュレート88は、必ずしもタイミングよく燃焼除去されず、徐々に隔壁98に堆積する場合がある。例えば、内燃機関から温度の低い排気ガス8が排出されている間は、触媒作用によっても燃焼が開始せず、パティキュレート88の堆積のみが進行する。この場合には、排気ガス8がフィルタ、即

ち排ガス浄化フィルタ9を通過する際の圧力損失が増大し、また燃焼熱によりフィルタが異常加熱され割れもしくは溶損するという問題を招いてしまう。

[0006]

本発明はかかる従来の問題点に鑑みてなされたもので、パティキュレートの堆積による過剰な圧力損失の発生を抑制また割れや溶損を防止することができる排ガス浄化フィルタを提供しようとするものである。

[0007]

#### 【課題の解決手段】

請求項1の発明は,隔壁に囲まれた多数のセルを有するハニカム状の排ガス浄 化フィルタにおいて,

上記セルの両端のいずれか一方の端部に栓を有し、上記排ガス浄化フィルタの 両端面上において上記栓のある端部と無い端部とがそれぞれ交互に位置し、

流体経路の下流側に配設されるべき上記栓の少なくとも一部は,流体が貫通可能な開口部を有する部分枠であり,

かつ,上記セルに進入した流体が上記隔壁を通過する際の圧力損失が,上記部 分栓を通過する圧力損失よりも小さくなるよう構成されていることを特徴とする 排ガス浄化フィルタにある。

[00008]

次に、本発明の作用につき説明する。

本発明の排ガス浄化フィルタは、上記セルの下流側において上記開口部を有する部分栓を有している。そして、この部分栓は上記の圧力損失関係を有する。言い換えれば、部分栓の方が隔壁よりも流体の通過抵抗が大きくなるよう構成されている。

そのため、流体である排気ガスがセル内に進入した際には、部分栓に開口部が あってもここを殆ど通過せず、隔壁を通過して隣の栓のないセルから排出される 状態が得られる。

それ故, 排気ガス中のパティキュレートは隔壁に捕集され, ヒータ等による加熱, もしくは排ガス浄化フィルタの隔壁に担持される触媒の作用によって適宜燃焼除去される。

[0009]

一方、ヒータ等による加熱もしくは触媒作用による燃焼がなかなか生じない場合には、徐々に隔壁にパティキュレートが堆積する。この場合には、隔壁を流体が通過する際の圧力損失が大きくなり、部分栓における圧力損失と逆転する。

このようなパティキュレートの堆積が進んだ異常状態においては、セルに進入した流体が部分栓の上記開口部から排出される状況を作り出すことができる。これにより、異常時における過剰な圧力上昇は回避される。そして、その後、触媒作用によるパティキュレートの燃焼除去が実施された際には、初期状態に再生され、隔壁を通過する流体流れが復活し、パティキュレートの捕集が再開される。

[0010]

したがって本発明の排ガス浄化フィルタによれば、パティキュレートの堆積に よる過剰な圧力損失の発生を抑制すると共に割れや溶損を防止することができる 排ガス浄化フィルタを提供することができる。

[0011]

次に、請求項2の発明のように、上記上流側に位置する栓のすべては、流体の 通過を完全に遮断する完全な栓であることが好ましい。上流側を部分栓にした場 合には、直接的に部分栓の開口部から流体が進入する状態が生まれ、パティキュ レートの捕集効率が低下するおそれがある。上流側に位置する栓のすべてを完全 な栓にすることによって、捕集効率の低下を抑制することができる。

[0012]

また、請求項3の発明のように、上記部分栓の上記開口部の面積をB、上記セルの開口面積をAとした場合、栓詰め率((A-B)/A)×100が5~80%の範囲にあることが好ましい。上記栓詰め率が5%未満の場合には、部分栓を流体が通過する際の圧力損失があまり大きくならず、直接貫通する割合が増加し、パティキュレートの捕集効率が低下するおそれがある。一方、上記栓詰め率が80%を超える場合には、完全な栓を部分栓に変更した上記作用効果が十分に発揮されないおそれがある。

[0013]

また,請求項4の発明のように,上記排ガス浄化フィルタの下流側端面に位置



する上記栓のうち、上記下流側端面の中央部分に位置する上記栓が上記部分栓であり、その周囲に位置する上記栓は流体の通過を完全に遮断する完全な栓とすることができる。流体である排ガスの流速分布は中央ほど高くなる傾向にあり、中央部分の圧力上昇がその周囲よりも大きい。そのため、過剰圧力上昇の回避作用を排ガス浄化フィルタの中央部分にのみ持たせても上記作用効果を十分に発揮させることができる場合がある。

[0014]

また,請求項5の発明のように,上記排ガス浄化フィルタの下流側端面に位置する上記栓のすべてが上記部分栓である構造をとることもできる。この場合には,流体の流速分布に関係なく,十分に過剰圧力上昇を回避することができる。

[0015]

【発明の実施の形態】

#### 実施形態例1

本発明の実施形態例にかかる排ガス浄化フィルタにつき,図1~図4を用いて 説明する。

本例の排ガス浄化フィルタ1は、隔壁11に囲まれた多数のセル10を有する ハニカム状の排ガス浄化フィルタである。

上記セル10の両端のいずれか一方の端部に栓2,3を有する。そして、排ガス浄化フィルタ1の両端面18,19上において上記栓2,3のある端部と無い端部とがそれぞれ交互に位置する。

[0016]

また、流体経路の下流側に配設されるべき上記栓の少なくとも一部は、流体が 貫通可能な開口部30を有する部分栓3である。

かつ,上記セル10に進入した流体が上記隔壁11を通過する際の圧力損失が ,上記部分栓を通過する圧力損失よりも小さくなるよう構成されている。

以下、これを詳説する。

[0017]

本例の排ガス浄化フィルタ1は、図1、図2に示すごとく、四角形状の断面空間を有するセル10を有する円筒状のハニカム構造体よりなる排ガス浄化フィル

タである。全体サイズは、直径 $140mm\phi$ 、長さ130mmとし、セルサイズは12mil、300メッシュとした。

図1,図2に示すごとく、排ガス浄化フィルタ1の下流側端面19に位置する セル端部は、市松模様状に栓2,3がある部分と無い部分とが交互に位置されて いる。

#### [0018]

そして、本例では、下流側端面19における栓の殆どを開口部30を有する部分栓3とし、若干ではあるが外周端部に位置するセルには開口部のない完全な栓2を配置した。

上記部分栓3は、図1に示すごとく、略円形状の開口部30をほぼ中央部に設けたものである。

この部分栓3は、開口部30の面積をB, セル10の開口面積をAとした場合 , 栓詰め率((A-B)/A)×100が5~80%の範囲にある。大半は約7 0%である。

#### [0019]

また、図2に示すごとく、上記下流側端面19において栓2、3を設けなかったセル10の反対側端部、即ち排ガス浄化フィルタ1の上流側端面18に位置するセル端部には、完全な栓2を設けた。したがって、この上流側端面18においても市松模様状に栓2が配置されている。

#### [0020]

また,上記隔壁11には多数の空孔が形成されており,排気ガスが通過できるようになっている。

そして、本例においては、セル10に進入した排気ガスがこの隔壁11を排気ガスが通過する際の圧力損失が、セル10から部分栓3の開口部30を通過する際の圧力損失よりも小さくなっている。

#### [0021]

上記排ガス浄化フィルタ1を製造するに当たっては、まず、セラミック原料を秤量し、混合撹拌した後、成形機によりハニカム状に押し出し成形する。次いで得られたハニカム状の成形体を乾燥した後、約1400℃で焼成した。これによ

り、まだ栓のない排ガス浄化フィルタ1が得られる。

上記セラミック原料としては、 $SiO_2$ 原料を19%(重量%、以下同様)、 $MgO\cdot SiO_2$ 原料を36%、 $Al_2O_3$ 原料を45%を主原料として用いた。これに外%の換算で、造孔剤を21.6%、バインダを13.5%、水を34%加えた。

[0022]

次に、栓のない排ガス浄化フィルタ1のセル10の端部に栓2、3を配設する

本例においては、完全な栓2も部分栓3もすべてディッピング方法により、以下のように形成した。

まず、ディッピング用のスラリーを2種類準備した。

第1のスラリーは,排ガス浄化フィルタ1の上流側端面18を浸けるためのものであり,比較的濃度の濃いものである。具体的には,上記セラミック原料を主成分とし,外%の換算で水80%を加えたスラリーである。

第2のスラリーは、上記セラミック原料を主成分とし、外%の換算で水150%を加えたスラリーである。

[0023]

次に、図4 (a)に示すごとく、栓のない排ガス浄化フィルタ1の両端部の外 周部に、外周面保護用のテープ71を貼り付けた。

次に、図4(b)に示すごとく、上流側端面18及び下流側端面19に樹脂フィルム72を貼り付けた。樹脂フィルム72としては厚さ0.1mmのビニールテープを用いた。

次に、図4(c)に示すごとく、栓2、3を設けるべき位置に対応する上記樹脂フィルム72を半田ごてのような加熱した治具を接触させることにより熱で貫通孔720を設けた。これは、上流側端面18と下流側端面19のそれぞれにおいて行った。

[0024]

次に、図4(d)に示すごとく、第1のスラリー75を入れた容器76を準備 し、これに排ガス浄化フィルタ1の上流側端部18を浸漬した。そして、上記樹

脂フィルム72の貫通孔720から第1のスラリー75を適量進入させた。

次に、第2のスラリーを入れた容器を準備して図4 (d) と同様にして排ガス 浄化フィルタ1の下流側端部19を浸漬した。そして、樹脂フィルム72の貫通 孔720から第2のスラリーを適量進入させた。

[0025]

次に,排ガス浄化フィルタ1を約1400℃で焼成し,樹脂フィルム72を焼 却除去すると共に上記2種類のスラリーを乾燥させた。

上流側端面18における第1のスラリーは、水分濃度が低くセル端部に十分付着した状態となっていたので、焼成後に穴のない完全な状態の栓2になった。

一方、下流側端面19における第2のスラリーは、水分濃度が高くセル端部に付着しにくいので、焼成後に開口部30を残したまま部分栓3となった。なお、本例では、下流側端面19の外周端部に位置する、一部が欠けた四角形状のセルは、開口面積が小さい関係から、完全な栓2となった部分があった。

[0026]

次に,上記排ガス浄化フィルタ1の作用効果につき説明する。

上記排ガス浄化フィルタ1は、開口部30を有する部分栓3を下流側に有している。そして、この部分栓3は上記のごとき圧力損失関係を有する。即ち、部分栓3の方が隔壁11よりも排気ガス8の通過抵抗が大きくなるよう構成されている。

そのため、図2に示すごとく、正常な状態においては、排気ガス8がセル10内に進入した際には、部分栓3に開口部30があってもここを殆ど通過せず、隔壁11を通過して隣の栓のないセル10に移動してから排出される。

それ故、排気ガス中のパティキュレートは隔壁11に捕集され、ヒータ等による加熱もしくは触媒作用によって適宜燃焼除去される。

[0027]

一方、図3に示すごとく、ヒータ等による加熱もしくは触媒作用による燃焼がなかなか生じない場合には、徐々に隔壁にパティキュレート88が堆積する。この場合には、隔壁11を排気ガス8が通過する際の圧力損失が大きくなり、部分栓3における圧力損失と逆転する。

このようなパティキュレートの堆積が進んだ異常状態においては、同図に示すごとく、セル10に進入した排気ガス8が部分栓3の開口部30から排出される状況を作り出すことができる。これにより、異常時における過剰な圧力上昇は回避される。そして、その後、ヒータ等による加熱もしくは触媒作用によるパティキュレート88の燃焼除去が実施された際には、初期状態に再生され、隔壁11による捕集が再開される。

[0028]

#### 実施形態例2

本例は、実施形態例1における部分栓3の開口部30の形状を変更した例である。

具体的には、図5(a)に示すごとく、実施形態例1と同様の円形状の開口部30を有する部分栓3の他に、同図(b)に示す楕円形の開口部30、同図(c)に示す樽型の開口部30、同図(d)に示す四角形の開口部30を有する部分栓3を適宜採用することができる。

[0029]

さらに、図5(e)(f)に示すごとく、開口部30を中央部ではなく周辺に 設けた構造をとることもできる。これらの形状は、主に製造方法によって左右される。

いずれの形状の開口部30を有する部分栓3を採用しても、隔壁11との圧力 損失の関係が実施形態例1と同様に維持される以上、実施形態例1と同様の作用 効果を得ることができる。

[0030]

#### 実施形態例3

本例は、実施形態例1における排ガス浄化フィルタ1の部分栓3の配設方法の 別例を示す例である。

即ち、本例においては、実施形態例1における第1のスラリーと同様のスラリー77を準備する。そして、図6に示すごとく、部分栓3を配設したいセル端部の内面に少しずつスラリー77を付着させ、開口面積を徐々に小さくする。そして、焼成することにより、開口部を有する部分栓を設けることができる。

この場合にも,実施形態例1と同様の作用効果が得られる。

[0031]

なお、実施形態例1における第1のスラリーにディッピングした後、乾燥前に 細い棒状の治具により穴をあけてから焼成する方法、あるいは、焼成した後にド リルで穴をあける方法を採用することもできる。

さらに、あらかじめ開口部を設けた板状のセラミック板をセル端部の開口部分に接着する方法もある。

[0032]

実施形態例4

本例は、図7に示すごとく、排ガス浄化フィルタ1の下流側端面19において、その中央部分の領域300のみに部分栓を採用し、その周囲の領域200には完全な栓詰めを採用した例である。その他は実施形態例1と同様である。

この場合にも,実施形態例1と同様の作用効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施形態例1における、排ガス浄化フィルタの下流側端面を示す説明図。

【図2】

実施形態例1における、排ガス浄化フィルタの長手方向断面を示す説明図。

【図3】

実施形態例1における,隔壁にパティキュレートが堆積した際の排気ガス流れ を示す説明図。

【図4】

実施形態例1における, 栓詰め手順を示す説明図。

【図5】

実施形態例2における、部分栓の開口部形状の変形例を示す説明図。

【図6】

実施形態例3における,部分栓の栓詰め手順を示す説明図。

【図7】

実施形態例4における、部分栓を設けるエリアと完全な栓詰めのエリアを分け

#### た例を示す説明図。

【図8】

従来例における, 排ガス浄化フィルタの下流側端面を示す説明図。

【図9】

従来例における, 排ガス浄化フィルタの長手方向断面を示す説明図。

【図10】

従来例における、隔壁にパティキュレートが堆積した際の問題点を示す説明図

#### 【符号の説明】

- 1... 排ガス浄化フィルタ,
- 10...セル,
- 11...隔壁,
- 18...上流側端面,
- 19...下流側端面,
  - 2...完全な栓,
  - 3... 部分栓,
- 30... 開口部,
  - 8... 排気ガス,
- 88...パティキュレート,

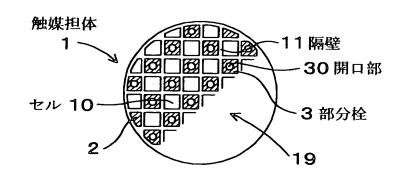


### 【書類名】

図面

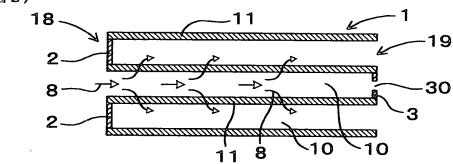
【図1】

(図1)



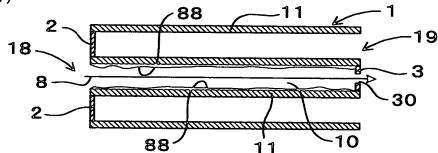
### 【図2】

(図2)



【図3】

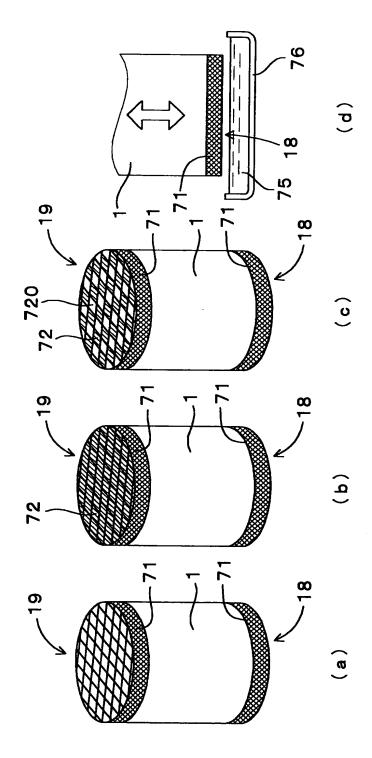
(図3)



1

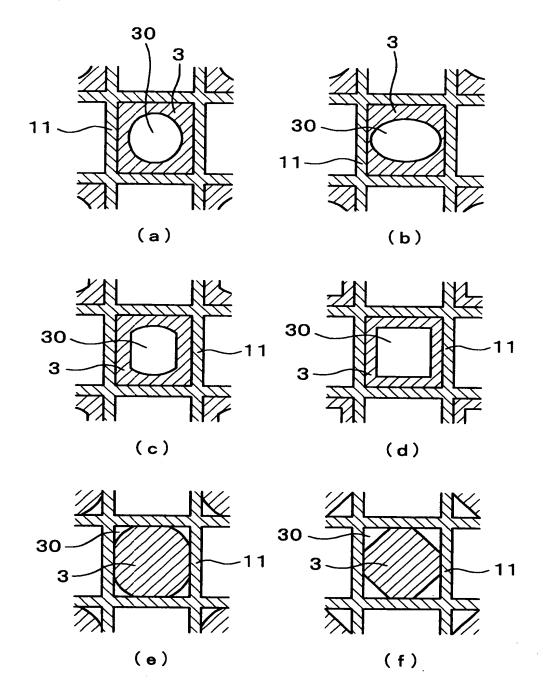
【図4】

(図4)



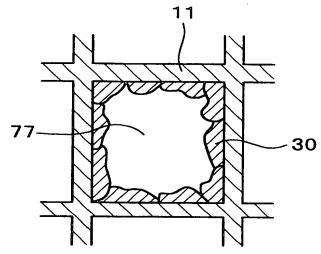
## 【図5】

## (図5)



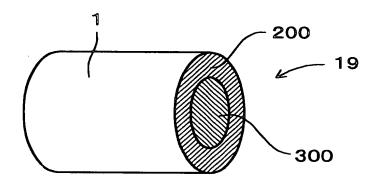
【図6】

(図6)



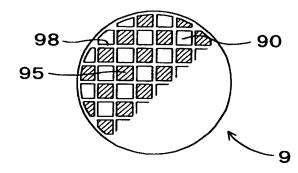
## [図7]

## (図7)



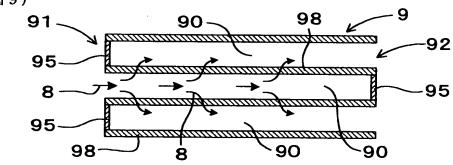
## 【図8】





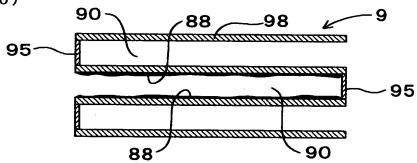
## 【図9】

(図9)



【図10】

(図10)



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 パティキュレートの堆積による過剰な圧力損失の発生を抑制することができる排ガス浄化フィルタを提供すること。

【解決手段】 隔壁11に囲まれた多数のセル10を有するハニカム状の排ガス 浄化フィルタ1であって、セル10の両端のいずれか一方の端部に栓2、3を有 する。排ガス浄化フィルタ1の両端面上において栓のある端部と無い端部とがそ れぞれ交互に位置する。流体経路の下流側に配設されるべき栓の少なくとも一部 は、流体が貫通可能な開口部30を有する部分栓3である。セル10に進入した 流体が隔壁11を通過する際の圧力損失が、部分栓3を通過する圧力損失よりも 小さくなるよう構成されている。

【選択図】 図1

### 出願人履歴情報

識別番号

[000004260]

1. 変更年月日

1996年10月 8日

[変更理由]

名称変更

住 所

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

氏 名

株式会社デンソー